(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2003 年10 月16 日 (16.10.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/085712 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/22

(21) 国際出願番号: PCT/JP03/03476

(22) 国際出願日: 2003 年3 月20 日 (20.03.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-103316 2002 年4 月5 日 (05.04.2002) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 本間 学 (HONMA,Manabu); 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP).

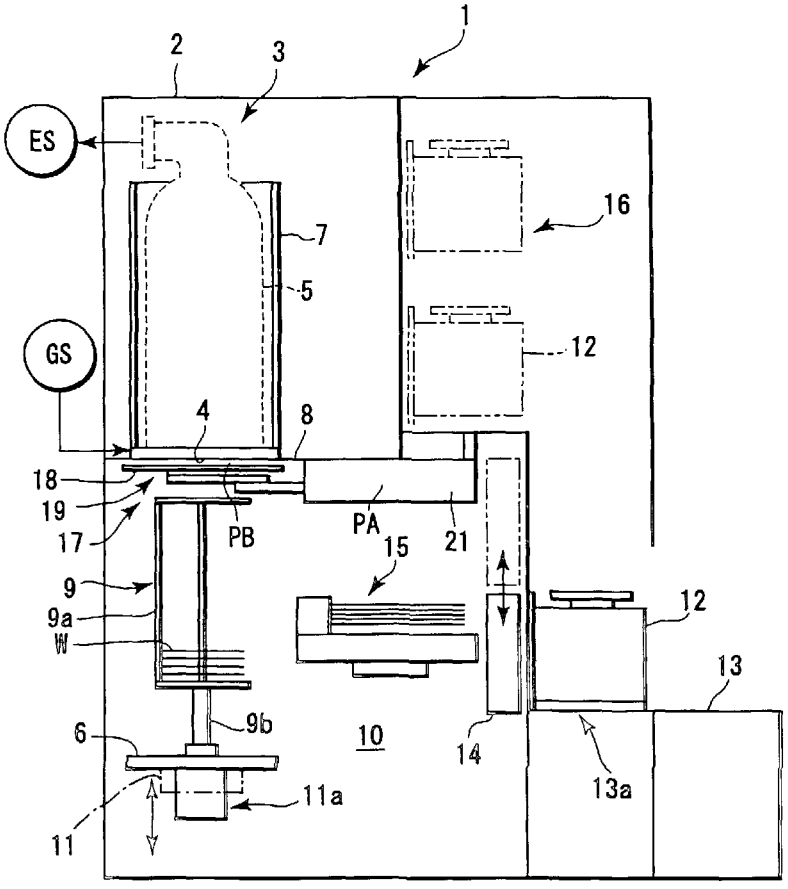
(74) 代理人: 鈴江 武彦， 外(SUZUYE,Takehiko et al.); 〒100-0013 東京都 千代田区 霞が関３丁目７番２号 鈴榮特許綜合法律事務所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG.

[続葉有]

(54) Title: VERTICAL HEAT TREATING EQUIPMENT

(54) 発明の名称: 縦型熱処理装置



(57) Abstract: Vertical heat treating equipment (1), comprising a shutter device (17) shielding a load port (4) when a processed substrate (W) is taken out from the load port (4) of a processing chamber (5), the shutter device (17) further comprising a port cover (18) selectively closing the load port (4) of the processing chamber (5), wherein the port cover (18) is driven by a drive part having an extension arm (19) supporting and moving the port cover (18), and the drive part linearly moves the port cover (18) through the extension arm (19) between a closing position (PB) for closing the load port (4) and a wait position (PA) on the side of the closing position (PB).

(57) 要約: 縦型熱処理装置（１）は、処理室（５）のロードポート（４）から被処理基板（Ｗ）が取り出され際にロードポート（４）を遮蔽するシャッターデバイス（１７）を有する。シャッターデバイス（１７）は、処理室（５）のロードポート（４）を選択的に閉鎖するポートカバー（１８）を有する。ポートカバー（１８）は、これを支持すると共に移動させる伸縮アーム（１９）を具備する駆動部によって駆動される。駆動部は、伸縮アーム（１９）を介して、ポートカバー（１８）を、ロードポート（４）を閉鎖する閉鎖位置（ＰＢ）と、閉鎖位置（ＰＢ）の側方の待機位置（ＰＡ）との間で直線的に移動させる。

WO 03/085712 A1

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。